

E2C[®]UV

Sistema de curado

El sistema UV de baja energía más potente para prensas de impresión de banda estrecha

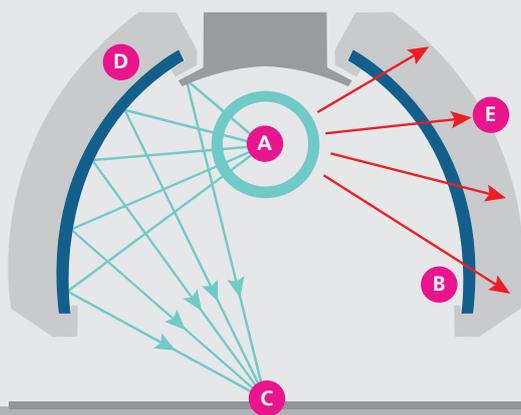


Producto diseñado y fabricado en el Reino Unido

gewuv.es

GEW
...engineering UV

Cabezal de lámpara E2C UV



- A Lámpara de alta potencia
- B Pérdida mínima de reflector
- C Perfil de radiación UV con ajuste óptico
- D Enfriado de reflector activo
- E Absorbe el calor



Mantenimiento mínimo

- Diseñado para cambios de lámpara más rápidos y sencillos
- Todos los componentes reemplazables son de instalación automática para un mantenimiento sencillo
- La trayectoria del flujo de aire activa patentada reduce el consumo y la contaminación de la lámpara y los reflectores: se requiere menos limpieza para mantener el rendimiento del curado

El sistema UV de baja energía más potente para prensas de impresión de banda estrecha

Curado UV GEW E2C

- Versátil, controlable y seguro para la gama más amplia de materiales sensibles al calor
- Tecnología de obturador refrigerado por aire patentado
- Sin transferencia de calor a la máquina o sustrato en estado de reposo
- Los reflectores de ajuste óptico aprovechan al máximo el efecto de curado de la lámpara
- La refrigeración por aire es ahora más efectiva que la refrigeración por agua
- Compatible con las mayores velocidades de impresión
- Dosis más alta + Intensidad más alta = curado máximo
- Listo para LED: teniendo una unidad de impresión híbrida, un casete LW2 LED y un casete de lámpara de arco E2C se pueden intercambiar en la misma unidad de impresión

Especificaciones

Potencia eléctrica máx.	140W / cm
Espectro	Mercurio**
Irradiación en el punto focal	5,8W / cm ² *
Dosis típica @ 100m / min	125mJ / cm ² *
Longitud máxima	60cm
Sección transversal estándar	110mm W x 190mm H
Refrigeración	Aire
Temperatura de funcionamiento estándar máx.	40°C (104°F)
Humedad estándar máx.	Sin condensación

*Medido en las condiciones del laboratorio estándar de GEW con una configuración estándar de cabeza de lámpara. ** Existen variables de lámpara disponibles bajo demanda.



Beneficios del sistema

Listo para LED

- Fácilmente se puede actualizar al curado UV LED en un futuro usando el mismo sistema de alimentación híbrido RHINO ArcLED

Mínimo costo total de propiedad

- Ahorro de energía del 45%
- Ahorra decenas de miles de Euros o Dólares durante la vida útil de su máquina
- Consumo de aire en la planta reducido

Medida de sostenibilidad fácilmente aplicable

- Reducción inmediata de la huella de CO₂
- Funcionamiento relajado y tranquilo sin necesidad de una costosa refrigeración de agua
- Elimina todo el consumo del aire de ambiente procesado con la opción de refrigeración NetZero

Garantía de 5 años

- Evita costos de mantenimiento imprevistos

Máxima productividad de la máquina

- Tecnología de inicio rápido de la lámpara
- El sistema evita proactivamente el tiempo de inactividad imprevisto
- Curado consistente de alta velocidad
- Instalación rápida

Disponible con curado de atmósfera inerte

- Permite la producción de protectores antiadherentes de silicón y envases de alimentos
- Consistencia del proceso asegurada con control del nivel de oxígeno de precisión integrado
- Soluciones totalmente diseñadas para adaptarse a su aplicación específica

Opciones

- Lámparas dopadas (Fe, Ga)
- Personalización para adaptarse a aplicaciones especializadas
- Monitoreo UV multipunto

¿Por qué usar GEW E2C?

- El sistema de curado UV refrigerado por aire más popular del mundo: **más de 30.000 unidades instaladas** (junio de 2022)
- Ofrece un **rendimiento de curado sin precedentes** gracias al diseño de reflector patentado y ultra eficiente
- Permite la impresión en la más amplia gama de materiales sensibles al calor debido a los **reflectores refrigerados activamente** por aire que reducen la transferencia de calor al sustrato
- **Máxima fiabilidad**, demostrada desde la primera instalación en junio de 2012

ArcLED Hybrid LED+UV



Los casetes ArcLED se pueden intercambiar de forma rápida y fácil; tan solo se necesita una llave Allen.

La tecnología UV híbrida ArcLED permite intercambiar una lámpara de arco de UV o un conjunto de LED en la misma unidad de Impresión.

Optimice su prensa con una mezcla de curado por arco y LED en cualquier estación, para conseguir la máxima flexibilidad.



No se preocupe... está en buenas manos

Servicio de monitoreo remoto de GEW



El monitoreo remoto es una tecnología IoT incluida de serie en todos los sistemas UV RHINO/RLT de GEW y está aprobada por Industry 4.0.

Este tipo de sistemas se observan de manera continua para garantizar un funcionamiento de máxima eficiencia en todo momento.

De este modo, GEW puede ofrecer la respuesta de servicio técnico más rápida y precisa del sector.

Informes de rendimiento del sistema

El historial de incidencias registra de forma continua el uso del sistema y genera informes periódicos para el cliente, en los que se detallan el uso de energía, la productividad de la máquina de impresión y el rendimiento del sistema.

Potencia RHINO

Potencia compacta y a prueba de fallos

Las unidades de potencia RHINO y RLT son compatibles con hasta 12 lámparas UV en un solo armario compacto de 1265mm x 800mm.

Las fuentes de alimentación han sido diseñadas para un uso a temperaturas ambiente de hasta 40°C y están protegidas frente a los problemas eléctricos más comunes (como cortocircuito a tierra, caídas de tensión) con un modo de apagado seguro, para un funcionamiento muy fiable.

Garantía de 5 años disponible



Con el paquete de mantenimiento integrado de GEW, podrá confiar plenamente en la electrónica de potencia de GEW, además de reducir los costes de mantenimiento imprevistos. **GEW es el único proveedor de UV que ofrece este nivel de garantía en todo su sistema.**



Oficina central

GEW (EC) Limited, Crompton Way, Crawley RH10 9QR, Reino Unido

Reino Unido +44 1737 824 500 Alemania +49 7022 303 9769

Estados Unidos +1 440 237 4439

E sales@gewuv.com W gewuv.es